



Industria Materiali Fotochimici SpA
 Tel.++39 0255302615 – Fax: ++39 0255302643 email: info@imaf.it

THERMAL TS-R - HUAGUANG

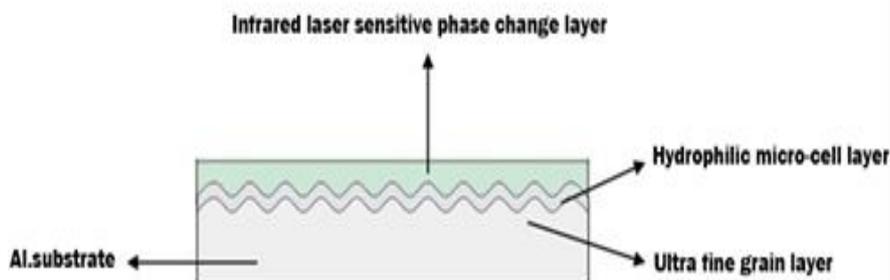
Lastra termica positiva per scrittura con laser a 800/850 nm.
 Alluminio anodizzato e microgranitura ottenuta con processo elettrochimico.

Ampia latitudine di processo, alta risoluzione e massima stabilità in macchina da stampa.
 Eccellenti performance con inchiostri sia convenzionali, sia UV, raggiunge fino a 350.000 copie.
 Per incrementarne la resistenza, la lastra TS-R può essere termoindurita.

Compatibile con i principali sviluppi in commercio, si raccomanda l'utilizzo di prodotti IMAF
 Con la soluzione Imaf low-chem PMA + PMR-Plus, la lastra TS-R, permette un drastico
 abbattimento dei consumi della chimica di sviluppo.

STRUTTURA THERMAL TS-R

Resistenza chimica/meccanica della superficie grazie alla maggiore densità dei polimeri,
 controllata da una tecnologia unica, brevettata da Huaguang.



Specifiche tecniche

TIPO DI LASTRA	Termica positiva
SUBSTRATO	Alluminio 1050 elettrochimicamente granito e anodizzato
STRATO SENSIBILE	Fotopolimerico alta densità (termico positivo)
SENSIBILITA' SPETTRALE	Ir 800-850 nm
ENERGIA LASER RICHIESTA	110-120 mj/cm2
RISOLUZIONE	1%-99% a 200 lpi
LUCE DI SICUREZZA	Non richiesta
SVILUPPO : THERM DEVELOPER PMA SVILUPPO :TECNO THERM- TECNO PLUS T° SVILUPPO TEMPO PERMANENZA	RIGENERO :THERM REPLENISHER PMR /PMR PLUS RIGENERO : TECNOTHERM-R TECNO PLUS R 21°C 23°C 30" -20"
GOMMA DI PROTEZIONE	Imaf Neogum / Tecnogum
COTTURA FORNO	Possibile / Termoprotettore - Imaf TP3001
TIRATURA	> 350.000 copie con inchiostri grassi/ 100,000 con inchiostri uv
TEMPO MASSIMO DI STOCCAGGIO	18 mesi dalla data di produzione a 25°C umidità 60% e nell'imballo

Rev. Del 06/12/2022